

Disciplina: Plasma: Fundamentos e aplicações tecnológicas - CH: 4

Ementa: Propriedades macroscópicas e microscópicas de gases, processos colisionais em gases, produção e propriedades de plasmas, arquitetura de descargas elétricas luminescentes DC e RF. Tratamento de materiais por plasma: nitretação, carbonetação e oxidação iônica. Deposição de filmes por pulverização catódica (Sputtering).

Bibliografia:

CHOPRA, K., Thin Film Phenomena, McGraw-hill, 1969.

LLEWELLYN-JONES, F., The Glow Discharge, Wiley, 1966.

MATTHEWS, A., Advanced Surface Coatings: a handbook of Surface Engineering, Chapman-Hall, New York.

CHAPMAN. E.B, Glow Discharge Processes, Sputtering and Plasma. Wiley, 1980.